맞춤형 Ptfe 웨이퍼 핸들링 랙 내부식성 고온 반도체 폴리실리콘 처리 스탠드

품목 번호: PL-CP287

소개

극한 화학 환경 및 고온 반도체 공정을 위해 설계된 프리미엄 맞춤형 PTFE 웨이퍼 스탠드입니다. 이러한 내부식성 캐리어는 중요한 폴리실리콘, 태양광 및 첨단 전자 제조 공정에서 고순도 핸들링, 저마찰 작동 및 뛰어난 내구성을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
실리콘 웨이퍼 에칭	강력한 불화수소산 및 질산 혼합물에 침지하는 동안 실리콘 웨이퍼를 안전하게 고정합니다.	뛰어난 내산성 및 제로 오염.
RCA 세정 공정	암모니아와 과산화수소를 사용하는 다단계 세정 공정에서 캐리어로 사용됩니다.	강력한 산화제에 의한 열화에 저항합니다.
태양 전지 생산	태양광 산업의 도핑 및 표면 텍스처링 공정 중 태양광 기판을 지지합니다.	높은 열 안정성과 화학적 불활성성.
폴리실리콘 잉곳 핸들링	정제 및 분석 중 고순도 폴리실리콘 조각의 배치를 관리합니다.	금속 이온 침출 및 표면 접촉 손상을 방지합니다.
미량 분석 실험 기구	분석 화학에서 고순도 샘플의 저장 및 운반을 위한 특수 랙으로 작동합니다.	가장 높은 수준의 샘플 무결성과 순도를 보장합니다.
반도체 습식 벤치	대량 기판 세정 및 헹굼을 위한 자동 습식 공정 시스템에 통합됩니다.	낮은 마찰이 원활한 자동 핸들링을 촉진합니다.
전기도금 고정구	정밀 전착 공정 중 비전도성, 내화학성 지지대로 작동합니다.	전기 절연성과 화학적 안정성이 결합되어 있습니다.

매개변수	사양 세부 정보
제품 식별 코드	PL-CP287
기본 재료	고순도 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
제조 공정	정밀 CNC 가공 / 맞춤 제작
맞춤화 가능 여부	사용자 사양에 따라 완전히 맞춤 제작 가능
온도 범위	-200°C ~ +260°C
화학 적합성	범용 (대부분의 산, 염기 및 용매에 불활성)
표면 마감	고평활성, 논스틱, 소수성
슬롯 구성	너비, 깊이 및 피치 맞춤화 가능
적재 용량	기판 밀도 및 수량에 맞춰 제작
오염 관리	금속 무함유, 첨가제 무함유 구조
치수	고객 요구사항에 따라 맞춤 설계